



2019年8月23日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 オ プ ト ラ ン  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 林 為 平  
(コード番号：6235 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 高 橋 俊 典  
管 理 部 長 兼 経 営 企 画 室 長  
(TEL. 03-6635-9487)

### ALD 装置の開発完了について

当社では、光学薄膜をさらに発展させ、ALD（原子層堆積法）を用いた新型装置の開発を完了しましたので、お知らせいたします。当社グループの Afly solution Oy 社（フィンランド）の ALD 技術と当社のプラズマ技術とを融合し、光学薄膜用に最適化したプラズマ原子層堆積装置（A800P）の新たな開発を行っていましたが、完了したものです。

特徴は、レンズ局面や 3D 構造物等の複雑な表面へ均一・極薄・低温成膜をすることが可能です。また、プラズマ原子層堆積装置で従来課題となっていた大量成膜を実現するとともに、原料供給やプラズマ照射の最適化により 1 回あたりの成膜時間を短縮し、お客様の生産効率向上にも貢献いたします。

本装置は、スマートフォン等の高機能カメラレンズ反射防止膜やリチウムイオン電池・Micro LED の保護膜等の成膜での利用が期待されています。

当社は今後も成膜新技術を新型装置に反映し、新たな市場開拓に努めてまいります。

参考：

ALD (Atomic Layer Deposition:原子層堆積法) とは、フィンランドで開発された、真空を応用した成膜技術であり、原子の性質である自己制御性を利用して、一層ずつ原子を堆積させる成膜方法。

以上